

JP62011243





38

PROBER DEVICE HAVING TEMPERATURE CONTROL MEANS

Patent Number:

JP62011243

Publication date:

1987-01-20

Inventor(s):

OZAWA FUJIO; others: 01

Applicant(s)::

HITACHI ELECTRONICS ENG CO LTD

Requested Patent:

Application Number: JP19850145832 19850704

Priority Number(s):

IPC Classification:

the novel wafer 3 is placed on the table 1'.

H01L21/66; G01R31/26

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To elevate the temperature of a wafer to a fixed value rapidly with high precision by mounting an air-feeding hose and an air discharging hose and feeding and circulating a gas at a fixed temperature into a closed chamber in which the wafer is placed. CONSTITUTION: A tempered glass board 13 is releasably supported horizontally to the upper section of a table 1' driven in the X, Y, Z and theta directions while a hood 14 is fitted around the table 1', the upper end of the hood is brought into contact with the glass board 13 in a sliding manner, thus forming a closed space 15 to the upper section of the table 1'. The glass board 13 is the size capable of covering the range of the movement area of the table 1' when the table 1' is shifted in a horizontal surface. A probe card 11' is mounted onto the glass board 13. An air feeding hose 19 and an air discharging hose 20 are set up while penetrating these glass board 13 and card 11', and temperature- controlled air is fed and circulated into the space 15. Accordingly, the temperature of a wafer 3 is elevated quickly to a fixed value when

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 11243

⑤Int Cl.⁴

3

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)1月20日

H 01 L 21/66 G 01 R 31/26 7168-5F H-7359-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②特 願 昭60-145832

②出 顋 昭60(1985)7月4日

⑩発 明 者 小 沢 不 二 夫

神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

⑩発 明 者 興 津 光

神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

⑪出 願 人 日立電子エンジニアリ

ング株式会社

20代 理 人 弁理士 秋本 正実

東京都千代田区大手町二丁目6番2号

明 細 智

発明の名称

温度制御手段を備えたプローバ装置

特許請求の範囲

水平な直交2軸 X, Yに沿った水平面内と、垂 直軸乙に沿った垂直方向と、上記乙軸回りの8方 向とに精密に駆動されるXYZ8テーブル上にウ エハをチャックし、上記のウエハにプローブを接 触させて該ウエハに構成されている半導体回路の 電気的性能を検査するプローバ装置において、被 検査物であるウエハを載置するテーブル面の上方 に、該テーブルの水平面内移動範囲をカパーし得 る大きさの板状部材を水平に支承するとともに、 前記テーブルの周囲付近に筒状のフードを弾性的 に支承し、該フードの上端を前記板状部材に摺触 せしめて、テーブル上に載置したウエハを取り囲 む密閉室を形成するとともに、前記板状部材を貫 通せしめてプローブを支承し、かつ、前記の板状 部材に送気ホース及び排気ホースを貫通固者して、 前記密閉室の中に所定温度の気体を送給、循環せ

しめるように構成したことを特徴とする、温度制 御手段を備えたプローバ装置。

発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

本発明は、ウエハ面に設けられている半導体回路にプローブを接触導通せしめて電気的性能を検査するプローバ装置に係り、特に所定の検査条件温度で検査を行えるように改良したプローバ装置に関するものである。

(発明の背景)

I Cを製造する際、半導体ウエハの表面に多数の半導体回路(通常数10万至数100個)を配列して構成し、これを切断してそれぞれの切断片にリードを接続してモールド成形して完成 I C が得られる。

完成品の検査はICハンドラによって搬送しつ つICテスタによって自動的に行われる。

しかし、半導体回路に不良品が発生したときは、 なるべく初期の工程で発見、排除した方が、その 後の加工コストが節波されるので経済的である。

BEST AVAILABLE COPY

こうした観点から、IC製造工程の途中で、ウエハ段階のICの電気的特性を検査する為、プローバ装置が用いられている。

第2図は公知のプローバ装置の一例を示す模式的な垂直断面図である。

テーブル1の上面に真空吸着ベッド2を設けて ウエハ3がチャックされる。

上記のテーブル1は水平な直交2軸X, Yに沿って(Y軸は低面に垂直)特密に駆動され、垂直軸 Zに沿って精密に上下駆動され、かつ、 Z軸回りの 8 方向に特密に回転駆動される構造である。

即ち、4は、テーブル1を回動自在に支承しているペアリング、5は 8 方向の駆動用モータである。上記のモータ5に減速元歯車6aが固着され、テーブル1に減速受歯車6bが取り付けられている。

7はテーブル1を支承して Y 軸方向に案内する ガイドシャフト、8は Y 軸方向駆動モータ、8a は Y 軸方向送りネジである。

9は X 軸方向ガイドシャフトである。

しかし、上に述べたように熱風、冷風を吹きつけることによってウエハ3を所定温度ならしめるには長時間を要するので検査能率を低下させる。 その上、温度精度が悪くて検査信頼性が低い。 (発明の目的)

本発明は上述の事情に鑑みて為されたもので、 検査能率を低下せしめることなく、迅速に、かつ 高精度で、ウエハを所定の温度にすることのでき る、温度制御手段を備えたプローバ装置を提供し ようとするものである。

(発明の概要)

上記の目的を達成する為、本発明の装置は、水平な直交 2 軸 X , Y に沿った水平面内と、垂直軸 Z に沿った垂直方向と、上記 Z 軸回りの 8 方向と に精密に駆動される X Y Z 8 テーブル上にウエハをチャックし、上記のウエハにプローブを接触させて該ウエハに構成されている半導体回路の電気 的性能を検査するプローバ装置において、被検査 物であるウエハを載置するテーブル面の上方に、該テーブルの水平面内移動範囲をカバーし得る大

テーブル1上のウエハ3の上方に、対向せしめてプローブ針10,同10が配設される。該プローブ針10はプローブカード11に取り付けられている。プローブカード11は校査用の配線券板である。

上記の従来装置(第2図)を用いてウエハ3の半導体回路を検査するには、前記のXYZ 8 駆動手段によってテーブル1を動かし、プローブ針10の 先端を半導体回路(ウエハ3の上面)に接触,導通せしめて行われる。

上に述べた半導体回路の検査に当たって、製品の仕様に応じた検査条件温度が設定される。この検査条件温度は、例えば-50℃といった低温の場合もあり、又、例えば120℃といった高温の場合もある。

従来技術においては、上記のような低温若しくは高温でプローブ検査を行う場合、エアーノズル12を設けてプローブ針10の先端付近に向けて熱風又は冷風を吹きつけ、該熱、冷風によってウエハ3を加熱、冷却して所定温度ならしめてプローブ検査を行っている。

〔発明の実施例〕

次に、本発明の一実施例を第1図について説明 する。

この実施例の装置は、先に説明した従来例のプローバ装置に本発明を適用して改良したもので、第2回(従来例)と同一の図面参照番号にダッシを付した X , Y , Z , θ 方向に駆動されるテーブル 1 ′ は、前記従来例におけるテーブル 1 に対応する部材である。また、第2回と同一の図面参照番号を付した部材は前記従来例におけると同様乃至は類似の構成部材である。

BEST AVAILABLE COPY

テーブル 1′の上方に強化ガラス板13を水平に 支承すると共に、テーブル 1′の周囲にフード14 を設け、その上端を強化ガラス板13に摺触せしめ て、テーブル 1′の上方に密閉空間15を形成する。

上記の強化ガラス板13の大きさは、テーブル 1′がX, Y 軸に沿って水平面内で移動したとき、 その移動区域範囲をカバーできる大きさとする。

前記のフード14は円筒状に構成し、スプリング 16によって上方に付勢する。本例のフード14はテ フロン(商標名)を用いて強化ガラス板13に対する 瞭撚抵抗を少なくするように、かつ、耐熱。耐冷 性に優れたようにしてある。

前記のフード14の外側に円周状のリップ17を設けてフード14の気密性を完全ならしめると共に、 該リップ17にホース18を賞通固着してドライエア を送入できるように構成する。

前記の強化ガラス板13の上にプローブカード 11′を取りつける。このプローブカード11′にはプローブ針10の先端が見えるように、ガラスを嵌め こんだ覗き窓11aを設けてある。

動を妨げる虞れが有るので、そのような場合はホ ース18からドライエアーを供給して除霜する。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明の温度制御装置によれば、被検査物であるウエハを迅速に所定温度ならしめることができるので高能率で検査を遂行することができ、しかも該ウエハを正確に所定温度に保持することができるという優れた実用的効果を奏する。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の温度制御手段を備えたプロー バ装置の一実施例を模式的に描いた断面図である。 第2図は従来技術に係る温度制御装置を説明す る為の模式的な断面図である。

1,1'… X,Y,Z,8方向に駆動されるテーブル、2…真空吸着ベッド、3…被検査物であるウェハ、10…プローブ針、11,11'…プローブカード、11a…覗き窓、12…エアーノズル、13…強化ガラス板、14…フード、15…密閉空間、16…スプリング、17…リップ、19…送気ホース、20…

前記の強化ガラス板13およびプローブカード
11、を貫通せしめて送気ホース19及び排気ホース
20を取りつけ、温度制御された空気(-50℃~120℃
の範囲内で任意の温度に冷し若しくは熱した空気)
を密閉空間15に送給、循環せしめ得るように構成
する。

以上の如く構成した本実施例の装置を使用する には、所定温度の空気を送気ホース19から送入し つつ排気ホース20から流出せしめて循環させる。

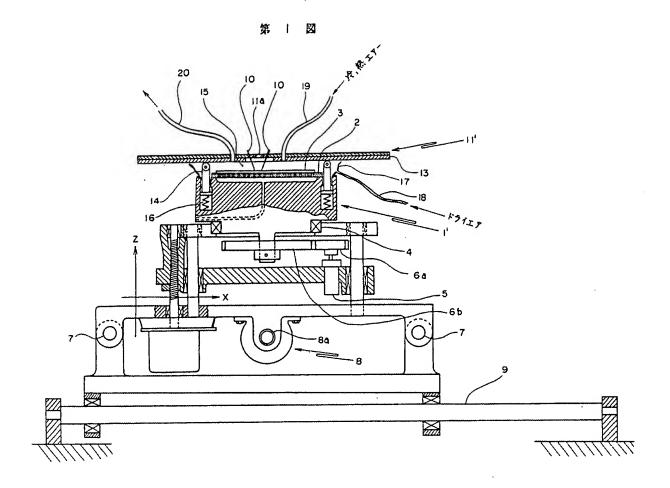
暫時循環させると、密閉空間15を取り囲んでいる部材(真空吸着ベッド2・強化ガラス板13・フード14)がほぼ所定温度になる。このため、テーブル1を下降させて新しいウエハ3を置くと速やかに所定温度になる。

また、ウエハ3に着目すると、該ウエハ3を取り囲んでいる雰囲気及び取り囲んでいる部材が総 べて所定温度になっているので、該ウエハ3は所 定温度に安定し、正確に所定温度に保持される。

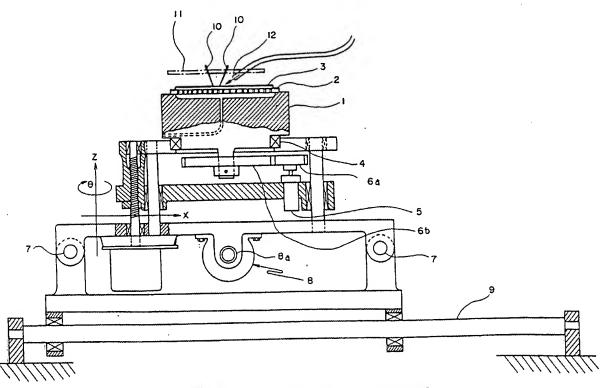
密閉空間を室温以下の低湿に保つ場合は、リップ17と強化ガラス板13との摺触部に霜を生じて摺

排気ホース.

特 許 出 顧 人 日立電子エンジニアリング株式会社 代理人弁理士 秋 本 正 実







BEST AVAILABLE COPY